イオンミリング装置

目的　ドライプロセスでの微細加工装置として、幅広い用途で使用される。化学反応を伴わない物理的なエッチングプロセスの為、Au, Pt，磁性材料、金属多層膜なども簡単に加工可能。

仕様　(株)伯東
20cm カウフマン型イオンソース搭載
基板サイズ:Φ4 インチ
自公転運動を行うプラネタリーステージ採用し、良好な均一性を実現
ガス:Ar

利用手順
利用希望者は、事前に装置管理者に電話で申請すること。申請内容は、利用希望日時、所属研究室、氏名。利用後は、備え付けの使用記録簿に所定の事項を記入すること。

利用上の注意
所定の講習を受け、装置動作原理を理解し、装置の取り扱いに習熟した者のみに本装置の利用を認める。装置の異常が発生した場合には速やかに装置管理者に連絡すること。

設置場所　実験室 1

装置責任者　電子情報部門　尹友（TEL:1724）

連絡先（装置管理者）　電子情報部門　尹友（TEL:1724, email: yinyou@gunma-u.ac.jp）